## JP63190204

# Title: CONDUCTING FINE PELLET

Abstract:

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-190204

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)8月5日

H 01 B 1/22 5/16

Z-8222-5E 7227-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

**砂発明の名称** 導電性微球体

②特 願 昭62-21187

②出 願 昭62(1987)1月30日

⑫発 明 者 神 吉 和 彦

京都府宇治市木幡平尾29番地の95

①出 願 人 積水フアインケミカル

大阪府大阪市北区西天满2丁目4番4号

株式会社

20代 理 人 弁理士 山本 秀策

## 明細書

## 1. 発明の名称

導電性微球体

### 2. 特許請求の範囲

1. 樹脂微球体の表面にニッケルおよび/またはコバルトからなる導電薄膜層が形成された導電性微球体であって、

該導電薄膜層にリンを 1.5~4 重量%の割合で 含有する導電性微球体。

- 2. 前記樹脂微球体が、ポリエチレン、ポリプロピレン、メチルペンテンポリマー、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリ塩化ビニル、ポリファ化ビニル、ポリテトラフルオロエチレンスリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリアクリロニトリル、ポリカーボネート、ポリアクリロニトリル、ポリアセタールおよびポリアミドのうちの少なくとも一種の線状重合体である特許請求の範囲第1項に記載の導電性微球体。
- 3. 前記樹脂微球体が、ジビニルベンゼン、へ キサトリエン、ジビニルエーテル、ジビニルスル

and the contract of the contra

4. 前記導電薄膜層の厚みが0.01~5 μm の範囲である特許請求の範囲第1項に記載の導電性微球体。

### 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、高温下や高温下にて耐圧縮性に優れ、 かつこれら条件下でも選電性が良好な選電性微球 体に関する。

性粒子は、高温状態に長時間放置したり水蒸気に

昼時間接触させると、メッキ層が侵され変質する。

そのため、遅電性粒子の電気抵抗が増大し導電性

が低下する。しかも、この導電性粒子は、メッキ

層が硬すぎて可撓性が不足しているため、非導電

性粒子と導電メッキ層との間の密着性に欠ける。

従って、この導電性粒子に圧縮荷重をかけると、

導電メッキ層が非導電性粒子から剝離しやすい。

**再電メッキ層は脆いため、圧縮荷重により破壊さ** 

#### (従来の技術)

導電性ペースト、導電性接着剤、導電性粘着剤 あるいは異方導電フィルムなどの導電性材料には、 羽盆性粒子と樹脂とからなる組成物が用いられて いる。この導電性粒子には、一般に、金、銀、二 ッケルなどの金属粒子がある。しかし、このよう な金属粒子は、樹脂にくらべて比重が大きく、形 状も不定形であるため、樹脂中で不均一に存在し やすい。そのために導電性にむらが生じる。この ような欠点を解決するために、特開昭59-28185号 公報には、金属粒子の代わりに、粒径の均一なガ ラスピーズ、グラスファイバー、プラスチックボ ールなどの非導電性粒子の表面に、金、銀、スズ、 飼、ニッケル、コバルトなどをメッキによりコー ティングした導電性粒子が開示されている。特に、 ニッケルやコバルトをメッキすれば、メッキ層が 酸化の影響を受け難いため、常態では、導電性粒 子の導電性が良好に保たれる。しかも、これら導 電性粒子は安価に得られる。

しかし、ニッケルやコバルトをメッキした導電

本発明は上記従来の問題点を解決するものであ り、その目的とするところは、高温下や高湿下に

(発明が解決しようとする問題点)

れるおそれもある。

り、その目的とするところは、高温下や高温下に おいて、導電薄膜層が変質しにくく、そのため、 導電性が良好な導電性微球体を提供することにあ る。本発明の他の目的は、圧縮荷重をかけても、 導電薄膜層が樹脂微球体から剝離しにくい導電性 微球体を提供することにある。本発明の改壊が生 の目的は、圧縮荷重による導電薄膜層の破壊が生 じにくい導電性微球体を提供することにある。

### (問題点を解決するための手段)

本発明は、無電解ニッケルメッキ法により、樹脂微球体にニッケルメッキを施す際に、ニッケル 中に取り込まれるリン含有量を一定範囲に限定することにより、可挽性を有しかつ高温下や高温下でも変質しにくい導電メッキ層が得られる。しかも、上記方法はコバルトメッキ法にも適用される。との発明者の知見にもとづいて完成された。

本発明の導電性微球体は、樹脂微球体の表面に ニッケルおよび/またはコバルトからなる導電薄膜層が形成された導電性微球体であって、該導電 薄膜層にリンを 1.5~4 重量%の割合で含有して なり、そのことにより上記目的が達成される。

樹脂微球体としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、メチルペンテンポリマー、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリ塩化ピニル、ポリファ化ピニル、ポリテトラフルオロエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリプチレンテレフタレート、ポリカーポネート、ポリアクリロニトリル、ポリアセター

ル、ポリアミドなどの線状重合体がある。この樹 脂微球体は、例えば、ジピニルベンゼン、ヘキサ トリエン、ジビニルエーテル、ジビニルスルホン、 ジアリルカルピノール, アルキレンジアクリレー ト、アルキレンジメタクリレート、オリゴまたは ポリ (アルキレングリコール) ジアクリレート, オリゴまたはポリ (アルキレングリコール) ジメ タクリレート、アルキレントリアクリレート、ア ルキレントリメタクリレート、アルキレンテトラ アクリレート, アルキレンテトラメタクリレート, アルキレンピスアクリルアミド, アルキレンピス メタクリルアミドなどの架橋反応性単量体を,単 独もしくは他の重合性単量体と重合して得られる 網状重合体であってもよい。単量体としては、ジ . ピニルベンゼン、ヘキサトリエン、ジピニルエー テル、ジビニルスルホン、アルキレントリアクリ レート,アルキレンテトラアクリレートが好適で

これら樹脂微球体は、ラジカル開始剤および懸 濁安定剤によるパール重合によって形成される。

ラジカル開始剤には、ラウロイルパーオキサイド。 ベンゾイルパーオキサイド、アセチルパーオキサ ィド、ジクミルパーオキサイド、ジェープチルパ ーオキサイド、t-プチルパーオキシベンゾエー ト、t-プチルパーオキシオクトエート、t-プ チルパーオキシアセテート、ヒープチルパーオキ シィソプチレート, アゾピスイソプチロニトリル, アゾピスィソバレロニトリルなど公知のあらゆる 開始剤が使用される。ラジカル開始剤は、単量体 100 重量部に対して、 0.5~15重量部の割合で添 加される。 0.5重量部を下まわると、単量体の重 合率が著しく低下する。15重量部を上まわる量の 開始剤は必要ではない。懸濁安定剤は、重合反応 によって形成された樹脂微球体を反応系内に安定 に存在させるための添加剤であり、 例えば、ポリ ピニルアルコール、ポリアクリル酸、ポリメタク リル酸、ゼラチン、メチルセルロース、ポリメタ クリルアミド、ポリエチレングリコール、ポリエ チレンオキサイドモノステアレート、ソルピタン テトラオレエート、グリセリルモノオレエートが

これら単量体、開始刑および懸濁安定刑を含む 混合物は、適当な液体媒質中に分散させ、激しく 攪拌しながら微粒化し、これを加熱することによ り重合体となる。液体媒質には、通常、水が用い られる。重合反応は、未反応の単量体が消失する

まで持続される。得られた重合体は樹脂微球体と

ある.

なる.

樹脂微球体の粒子径は、上記工程における混合物の攪拌速度および攪拌時間により調節される。粒子径は $1\sim100\,\mu$ m が好ましい。さらに好適には $3\sim20\,\mu$ m が用いられる。 $5\sim15\,\mu$ m であればさらに好適である。粒子径には分布があるため、通常の方法により、分級するのが好ましい。あるいは、導電薄膜層形成後に分級してもよい。

このような樹脂微球体の表面には、金属蒸着やメッキ等によって専電薄膜層が形成される。 導電薄膜層は、例えば次のようにして形成される(以下本発明における樹脂微球体の導電薄膜層としては導電メッキ層を例にあげて説明する)。

専電メッキ層の形成工程は、エッチング、アク チベーションおよび化学メッキの各工程に分けら れる。

エッチング工程は、樹脂微球体の表面に凹凸を 形成させ、導電メッキ層の密着性を付与するため の工程であり、エッチング液には、例えば、カセ ィソーダ水溶液、濃塩酸、濃硫酸または無水クロ ム酸が用いられる。しかし、エッチング工程は必 ずしも必要ではなく、場合によっては省略するこ とも可能である。

アクチベーション工程は、エッチングした樹脂 微球体の表面に触媒層を形成させるとともにこの 触媒層を活性化させる工程である。触媒層の活性 化により、後述の化学メッキ工程における金属の 析出が促進される。触媒としては、樹脂微球体の 表面にPd<sup>2\*</sup>およびSn<sup>2\*</sup>が吸着される。この触媒層 に濃硫酸または濃塩酸を作用させ、

 $Sn^{x*} + Pd^{x*} \rightarrow Sn^{4*} + Pd$ 

の反応により、Pd\*\*の金属化を行なう。金属化さ

れたパラジウムは、カセイソーダ濃厚溶液などの パラジウム活性剤により活性化され増感される。

化学メッキ工程は、触媒層が形成された樹脂微 球体の表面に、さらに導電メッキ層を形成させる 工程である。例えば、ニッケルメッキの場合には、 ニッケルイオン供給物質として硫酸ニッケルを用 い、これに、還元剤として次亜リン酸ナトリウム が加えられる。アクチベーション工程により上記 樹脂微球体の表面に吸着されたパラジウムが触媒 となり、硫酸ニッケルの還元反応が進行して、ニ ッケル金属が樹脂微球体表面に折出する。この場 合、得られた導電メッキ層のニッケル中にリンが 合金の形で取り込まれる。このリンの含有量は、 導電性微球体の物性に大きく影響することを, 木 発明者は見出した。リンの含有率が4重量%を上 まわると、導電性微球体の導電性の初期性能が低 下するうえに、高温下や高温下に長時間放置する と、導電メッキ層が侵され変質して、導電性が低 下する傾向にある。リンの含有率が4重量%以下 では、導電性の初期性能が向上するうえに高温下

や高湿下に放置しても導電性の変化はほとんど見られない。しかし、リンの含有率が 1.5重量%を下まわると、ニッケルメッキ層の結晶性が高くなり過ぎ、硬さが増して可提性が不足するため、樹脂微球体と導電性粒子に圧縮荷重をかけると、導電メッキ層は脆いため、圧縮荷重により破壊されるおそれもある。これらのことから、導電メッキ層のリン含有率は、 1.5~4 重量%が好ましい。

リンの含有率の決定は、メッキ反応槽のpHを制御することによりなされる。次亜リン酸ナトリウムではが大き、反応槽のpHは増大し、フェは高くなる。他方、水酸化アンモニウムでは、カーのでは、カーのでは、カーのではでは、カーので低電のレベンをでは、カーので低でで低ででででは、カーのではでは、カーのではでは、カーのではではできると、一般には、カーのではではでは、カーのではではできると、一般には、カーのではではできると、一般には、カーのではでは、カーのではでは、カーのではでは、カーのではでは、カーのではでは、カーのではでは、カーのではでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーでは、カーの

#### (実施例)

以下に本発明を実施例について述べる。

## 実施例1

## (1) 導電性微球体の作製

樹脂微球体として、ジビニルベンゼンの懸濁 重合により得た球状重合体(平均粒径10μm, 標 準偏差0.35に分級した)を用いた。

この樹脂微球体10gを、粉末メッキ用ブリディップ液(奥野製薬社製)に室温で30分間浸漬してエッチングした。水洗し、次いで、キャタリスト C液(奥野製薬社製)10㎡、37%塩酸10㎡、メタノール10㎡に室温で30分間浸漬してアクチベートした。さらに、この樹脂微球体を5%硫酸ニッケル17g/100㎡、次亜リン酸ナトリウム17g/100㎡の組成からなるpH9.4の無電解ニッケルメッキ液を調製した。この無電解ニッケルメッキ液を調製した。この無電解ニッケルメッキ液を調製した。この無電解ニッケルメッキ液を調製した。この無電解ニッケルメッキ液に上記樹脂微球体を投入し、70℃、10分間浸漬して遅電メッキ層を形成した。次いで、これを充分水洗した後乾燥し、導電性微

メッキ層との無膨張率の差などから、 導電メッキ 層が樹脂微球体の表面から剝離し易くなる。

コバルトメッキの場合には、上記の硫酸ニッケルに代えて硫酸コバルトを用いること以外は、全 く同様にして行われる。

## 球体を得た。

## (2) 導電性微球体の定量分析

(1) 項で得られた導電性微球体を所定量秤量し、これを 5 %硝酸水溶液に溶解させた。この溶液を ICP 発光分析装置(セイコー電子工業社製)により定量分析した。その結果、この導電性微球体 1 g 当たり、ニッケル0.27g およびリン 0.010g が含有されていた。従って、導電メッキ層中のリンの含有率は 3.6重量%であった。

#### (3) 導電性微球体の評価

(1)項で得られた導電性微球体について、以下のようにして、導電性(常態、高温処理後および高温処理後)および圧縮荷重に対する耐圧縮性を測定した。これらの結果を下表に示す。

## (A) 導電性

エボキシ接着剤 SE-4500 (吉川化工社製) , 100 重量部に対し、(1)項で得られた導電性 微球体 4 重量部を混合し、ベースト状に調 製した。

異方導電テスト基板として、34μα厚の

銅板を50μm 厚のポリイミドフィルムに貼 り合わせ、エッチング処理により、電極部 が, 400 μm ピッチになるように作製した 基板を用いた。この異方導電テスト基板 2 枚を対向させ、オーバーラップ部が2 mmに なるように配置し、導電性微球体を分散し たペーストで接着した。接着条件は、プレ ス圧10kg/cmで 140℃, 1時間の加熱であ った。このように接着した基板の各対向電 極間の抵抗値(Ω)を測定した。さらに、 この基板を 150℃で 500時間加熱後 (高温 処理後)の抵抗値および 121℃で2気圧の 水蒸気中に50時間放置した後(高温処理後) の抵抗値を測定した。これらの抵抗値測定 を15個の試料について行い、抵抗値の平均 値および標準偏差を算出した。その結果、 常態での平均抵抗値は0.50Ω、標準偏差は 0.12、高温処理後の平均抵抗値は0.60Ω、 標準偏差は0.10. そして高湿処理後の平均 抵抗値は0.93Ω, 標準偏差は0.35であった。

#### (B) 耐圧縮性

(A) 項において、基板同士を接着する際に、10 kg/cmのプレス圧を受けた後の導電性微球体を取り出し、走査型電子顕微鏡により10,000倍の倍率下で観察した。その結果、導電メッキ層の剝離や破壊はほとんど認められなかった。

#### 実施例2

無電解ニッケルメッキ液として、硫酸ニッケル17g/100ml、次亜リン酸ナトリウム10.3g/100ml およびピロリン酸ナトリウム34g/100ml の組成からなるpii10.0のメッキ液を用いたこと以外は、実施例1と同様にして導電性微球体を作製した。この導電性微球体1g当たり、ニッケル0.26gおよびリン 0.008gが含有されており、導電メッキ層中のリンの含有率は 2.0重量%であった。

この導電性微球体を用いて、実施例1と同様の方法により、導電性(常態、高温処理後、高温処理後、高温処理後)および耐圧縮性を測定した。その結果、常態での平均抵抗値は0.35Ω、標準偏差は0.06、高

温処理後の平均抵抗値は0.38Ω、標準偏差は0.07、そして高温処理後の平均抵抗値は0.72Ω、標準偏差は0.36であった。耐圧縮性では、10kg/cdのプレス圧を受けた後の導電メッキ層の剝離や破壊はほとんど認められなかった。

## 実施例3

無電解コバルトメッキ液として、硫酸コバルト18g/100ml、次亜リン酸ナトリウム25g/100ml およびピロリン酸ナトリウム34g/100ml の組成からなるpH10.5のメッキ液を用いたこと以外は、実施例1と同様にして導電性微球体を作製した。この導電性微球体1g当たり、コバルト0.23gおよびリン 0.006gが含有されており、導電メッキ層中のリンの含有率は 2.5重量%であった。

この選電性微球体を用いて、実施例1と同様の方法により、選電性(常態、高温処理後、高温処理後、高温処理後)および耐圧縮性を測定した。その結果、常態での平均抵抗値は0.67Ω、標準偏差は0.29、高温処理後の平均抵抗値は0.75Ω、標準偏差は0.30、そして高湿処理後の平均抵抗値は1.03Ω、標準偏

差は0.40であった。耐圧縮性では、10 kg / cm のプレス圧を受けた後の導電メッキ層の剝離や破壊はほとんど認められなかった。

#### 比較例 1

無電解ニッケルメッキ液として、硫酸ニッケル17g/100元、次亜リン酸ナトリウム24g/100元およびピロリン酸ナトリウム34g/100元の組成からなるpll 8.5のメッキ液を用いたこと以外は、実施例1と同様にして導電性微球体を作製した。この導電性微球体1g当たり、ニッケル0.27gおよびリン 0.013gが含有されており、導電メッキ層中のリンの含有率は 4.6重量%であった。

この再電性微球体を用いて、実施例1と同様の方法により、再電性(常態、高温処理後、高温処理後、高温処理後)および耐圧縮性を測定した。その結果、常態での平均抵抗値は0.75Ω、標準偏差は0.24、高温処理後の平均抵抗値は1.60Ω、標準偏差は0.42、そして高湿処理後の平均抵抗値は7.80Ω、標準偏差は1.20であった。耐圧縮性では、10㎏/cdのプレス圧を受けた後、再電メッキ層の剝離が認めら

れた。

#### 比較例 2

無電解コバルトメッキ液として、硫酸コバルト18g/100ml、次亜リン酸ナトリウム45g/100mlおよびピロリン酸ナトリウム34g/100mlの組成からなるpH 9.0のメッキ液を用いたこと以外は、実施例1と同様にして導電性微球体を作製した。この導電性微球体1g当たり、コバルト0.24gおよびリン 0.013gが含有されており、導電メッキ層中のリンの含有率は 5.1重量%であった。

この導電性微球体を用いて、実施例1と同様の方法により、導電性(常態、高温処理後、高温処理後、高温処理後、高温処理後、高温処理後の平均抵抗値は0.80 Q、標準偏差は0.46、高温処理後の平均抵抗値は1.55 Q、標準偏差は0.75、そして高湿処理後の平均抵抗値は5.70 Q、標準偏差は2.00であった。耐圧縮性では、10 kg/clのプレス圧を受けた後、導電メッキ層の剝離が認められた。

## 比較例3

よびピロリン酸ナトリウム34g/100配の組成からなるpH13.0のメッキ液を用いたこと以外は、実施例1と同様にして導電性微球体を作製した。この 連電性微球体1g当たり、コバルト0.25gおよび リン 0.002gが含有されており、導電メッキ層中 のリンの含有率は 0.8重量%であった。

この認定性微球体を用いて、実施例1と同様の方法により、認定性(常態、高温処理後、高温処理後、高温処理後)および耐圧縮性を測定した。その結果、常態での平均抵抗値は0.70 Q、標準偏差は0.21、高温処理後の平均抵抗値は3.54 Q、標準偏差は0.38、そして高湿処理後の平均抵抗値は1.03 Q、標準偏差は0.47であった。耐圧縮性では、10 kg/alのプレス圧を受けた後、導電メッキ層の剝離や破壊が認められた。

実施例および比較例から明らかなように、本発明の導電性微球体は、常態での導電性のみならず高温下や高湿下での導電性にも優れている。圧縮荷重を受けても、導電メッキ層の剝離や破壊はほとんど認められない。導電メッキ層のリン含有率

無電解ニッケルメッキ液として、硫酸ニッケル17g/100㎡、次亜リン酸ナトリウム 3.5g/100㎡ およびピロリン酸ナトリウム34g/100㎡の組成からなるpil14.0のメッキ液を用いたこと以外は、実施例1と同様にして導電性微球体を作製した。この導電性微球体1g当たり、ニッケル0.24gおよびリン 0.002gが含有されており、導電メッキ層中のリンの含有率は 0.8重量%であった。

この選位性微球体を用いて、実施例1と同様の方法により、選進性(常態、高温処理後、高温処理後)および耐圧縮性を測定した。その結果、常態での平均抵抗値は0.53 Q、標準偏差は0.17、高温処理後の平均抵抗値は2.75 Q、標準偏差は0.44、そして高温処理後の平均抵抗値は0.65 Q、標準偏差は0.44では、10kg/cdのプレス圧を受けた後、導電メッキ層の剝離や破壊が認められた。

#### 比較例 4

無電解コバルトメッキ液として、硫酸コバルト 18g/100ml、次亜リン酸ナトリウム10g/100mlお

が4重量%を上まわる運缸性微球体は、高温下や高温下において抵抗値が上がり、導電性が低下する。圧縮荷重により、導電メッキ層の剝離も生じる。リン含有率が 1.5重量%を下まわると、導電性は良好であるものの、圧縮荷重により導電メッキ層の剝離や破壊が認められる。

(以下余白)

表

	導電対す 層のリン含有率 (重量%)	溥 電 性			圧縮荷重 に対する 耐圧縮性
		常 態 (Q)	150℃,500時間 加熱後(Ω)	121℃, 2 気圧で 50時間放置後(Ω)	耐圧縮性
実施例1	3.6	0.50	0.60	0.93	良好
実施例 2	2.0.	0.35	0.38	0.72	良好
実施例 3	2.5	0.67	0.75	1.03	良好
比較例1	4.6	0.75	1.60	7.80	不良
比較例 2	5.1	0.80	1.55	5.70	不良
比較例3	0.8	0.53	2.75	0.65	不良
比較例 4	0.8	0.70	3.54	1.03	不良

## (発明の効果)

本発明の選電性微球体は、このように、高温下 や高温下においても導電薄膜層が変質しにた め、これら条件下でも選電性が良好である。しか も、圧縮荷重をかけても、導電薄膜層が樹脂 体から剝離しにくい。圧縮荷重による導関の の破壊も生じにくい。その結果、本発明の 導電性 做球体は、選電性ペースト、導電性接着剤、 異方導電性フィルム、電磁波シールド 樹脂用のフィラー、磁性材料などの用途に好適に 用いられる。

以上

出願人 積水77イングミカル株式会社 代理人 弁理士 山 本 秀 築